مطالعه ساختار نواری GeCH₃ تک لایه و ساختار تحت کشش بر اساس مدل تنگابست

 1 رضائى ، محسن 1 ؛ فضيله، فرهاد

1 دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان

چکیدہ

در این مطالعه یک مدل تنگابست برای ساختار دوبعدی GeCH₃ پیشنهاد شده و ساختار نواری حاصل با تنظیم ضرایب اسلاتر-کستر تطابق بسیار خوبی در نزدیکی انرژی فرمی با محاسبات ابتدا به ساکن دارد. با استفاده از این مدل تنگابست وجود گذار فاز توپولوژیک در این ماده تحت کشش تایید شده است.

Study the band structure of single-layer GeCH₃ and structures under biaxial tensile strain on the tight-binding model

Rezaei, Mohsen¹; Fazileh, Farhad¹

¹ Department of Physics, Isfahan University of Technology, Isfahan

Abstract

In this study we propose a tight-binding model for two dimensional structure GeCH₃. With proper tuning of Slater-Koster parameters the band structure of this model is in very good agreement with ab-initio calculations close to the Fermi energy. Using this tight-binding model it is shown that this system has a topological phase transition under strain.

PACS No.

مقدمه

اخیرا نارساناهای توپولوژیکی دو بعدی توجه فیزیکدانان زیادی را به خود جلب کرده است. این مواد دارای انبوهه ^۱عایق و حالت های لبه ای فلزی هستند [1]. رابطه پاشندگی حالت های لبه ای در نزدیکی سطح فرمی مانند فرمیون های دیراک خطی است که این موضوع می تواند در ترابرد حامل های بار در قطعات الکترونیکی بسیار موثر باشد.

یکی از ساختارهای پیشنهادی برای نارساناهی توپولوژیک، مواد با ساختار لانه زنبوری باکلینگ^۲ است .این مواد عمدتا از اتم های گروه IV جدول تناوبی که به دلیل داشتن هسته سنگین دارای اثر اسپین مدار قویتری هستند، ساخته می شوند.[2] در این کار ما روی ماده GeCH₃ (ژرمانین متیل جایگزین^۳) تک

Bulk¹

Buckling²

Methyl-substituted Germanane³



شکل I : ساختار GeCH₃ تک لایه از بالا (الف) و از پهلو (ب) ، گوی های خاکستری اتم Ge ، گوی های قرمز اتم کربن و گوی های سفید نشان دهنده اتم هیدروژن هستند.

مطابق شکل 2 یاخته اصلی GeCH3 همان یاخته شبکه لانه زنبوری است به طوری که در هر یاخته دو اتم Ge و دو ترکیب CH3 وجود دارد. ثابت شبکه این ماده، Å a=3.954 و طول پیوند بین اتم های Ge، Å 2.415 و طول پیوند بین اتم های Ge و کربن CH3 برابر Å 1.972 است[3].میزان انحراف از صفحه h بین دو اتم Ge برابر Å 0.788 است.

بر اساس محاسبات DFT در نزدیکی سطح فرمی حالت های موثر ناشی از اوربیتال های $4s \ e \ qb$ اتم Ge است. بدون در نظر گرفتن اثر اسپین مدار در نقطه Γ شکاف انرژی در ساختار نواری این ماده برابر $1.07 \ eV$ است. در نقطه Γ بالاترین نوار ظرفیت $^{5}(VBM)$ دارای تبهگنی دوگانه ناشی از اوربیتال های $xg \ e \ y$ است. وقتی اثر اسپین مدار اعمال شود این تبهگنی با یک شکاف به اندازه $193 \ meV$ برداشته می شود. پایین ترین نوار هدایت $^{6}(CBM)$ به وسیله حالت های اوربیتال 4s اتم Ge اشغال شده است[1].

- Buckling high ⁴
- Valance Band Maximum ⁵ Valance Band Minimum ⁶



شکل 2 : یاخته اصلی GeCH₃ تک لایه ، *t₁ و t₂* بردارهای انتقال شبکه (الف) و طول پیوند بین اتم های Ge و میزان انحراف از صفحه *h* (ب) ترکیب CH₃ در نظر گرفته نشده

هامیلتونی مدل تنگابست بدون اثر اسپین مدار

به دلیل اینکه حالت های موثر در نزدیکی سطح فرمی ناشی از اوربیتال های 4s ، 4s و 4py اتم Ge است ما برای این سیستم هامیلتونی مدل تنگابست شامل اوربیتال های s ، s و y اتم Ge پیشنهاد داده ایم که در نمایش کوانتش دوم بدون در نظر گرفتن اثر اسپین مدار به صورت

دهیم طوری که *b* فاصله بین اتم ها و *l* ، *m* و *n* کسینوس زاویه های هادی بین نزدیکترین اتم ها با محورهای مختصات باشد. مطابق با نظریه تنگابست[5] دامنه های پرش بین اتمی با روابط زیر داده می شود

 $t_{ii}^{ss} = V_{ss\sigma} \tag{2}$

- $t_{ii}^{sp_x} = lV_{sp\sigma} \tag{3}$
- $t_{ij}^{sp_y} = mV_{sp\sigma} \tag{4}$
- $t_{ij}^{p_x p_x} = l^2 V_{pp\sigma} + (1-l)^2 V_{pp\pi}$ (5)
- $t_{ij}^{p_{y}p_{y}} = m^{2}V_{pp\sigma} + (1-m)^{2}V_{pp\pi}$ (6)

$$t_{ij}^{p_{x}p_{y}} = lm(V_{pp\sigma} - V_{pp\pi})$$

$$(7)$$

$$- \sum_{pp\sigma} V_{pp\sigma} V_{pp\sigma} V_{sp\sigma} V_{ss\sigma} V_{ss\sigma} V_{ss\sigma}$$

$$V_{pp\pi} \phi V_{pp\pi} \phi V_{sp\sigma} V_{ss\sigma} V_{ss\sigma}$$

ما مقدار انرژی اوربیتال s را برابر eV eV eV $F_i^s = -12.00$ eV بهینه دادیم و بقیه پارامتر ها را با نتایج به دست آمده از DFT بهینه $V_{pp\sigma} = 3.60 \cdot V_{sp\sigma} = 2.56 \cdot V_{ss\sigma} = -2.38 \cdot \varepsilon_i^p = -3.00 \ eV$ است: $V_{pp\sigma} = -3.00 \ eV$ $v_{sp\sigma} = 2.56 \cdot V_{ss\sigma} = -2.38 \cdot \varepsilon_i^p$ e $V_{pp\sigma} = -1.14$ e $V_{pp\sigma}$ $V_{pp\sigma} = -1.14$ e $V_{pp\sigma}$ V_{e} $V_$

اثر کشش در GeCH₃ تک لایه

کشش می تواند حالت های لبه ای را در بسیاری از مواد با اثر اسپین مدار قوی، به وجود آورد بطوری که می تواند در دسته جدیدی از مواد به نام نارساناهای توپولوژی نقش مهمی ایفا کند.

Biaxial Tensile Strain 7

$$H_{SOC} = -\frac{\hbar}{4m_0^2 c^2} (\nabla V \times \vec{p}).\vec{\sigma}$$
(8)

داده می شود که در اینجا
$$\hbar$$
 ثابت پلانک و m_0 جرم الکترون



شکل 3: ساختار نواری مدل تنکابست بدون اعمال کشش (a) و با اعمال کشش (b). آزاد و σ سرعت نور ، V انرژی پتانسیل ، q تکانه و σ ماتریس های پائولی هستند. عمده سهم تزویج اسپین مدار ^۸ ناشی از اوربیتال های حول هسته اتم است به همین دلیل می توان انرژی پتانسیل (r) را با یک پتانسیل اتمی کروی تقریب زد. با میانگین گیری روی درجه آزادی شعاعی داریم (9)

شدت تزویج اسپین مدار و \vec{L} عملگر تکانه زاویه ای است. λ_i شدت تزویج اسپین مدار و \vec{L} عناصر ماتریس ناشی از اوربیتال های ($\boldsymbol{\beta}_{\alpha,\beta}$) در /تم $\langle \vec{L}.\vec{\sigma} \rangle_{\alpha,\beta}$ ام است[7].در سیستم های دو بعدی عناصر ماتریس $\vec{L}.\vec{\sigma}$ برای

Spin Orbit coupling (SOC) 8

اوربیتال های p_x ، s و p_y به صورت

$$\vec{L}.\vec{\sigma} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -is_z \\ 0 & is_z & 0 \end{bmatrix}$$
(10)

است. با بهینه سازی ویژه مقادیر هامیلتونی کل *(H=Ho+Hso)* با نتایج DFT مقدار شدت تزویج اسپین مدار *λi=0.096 به* دست می آید. با ترسیم ساختار نواری در دوحالت عدم وجود کشش و وجود کشش دو محوری، همانطور که در شکل های 4و5



شکل 4 : ساختار نواری GeCH₃ با وجود اثر اسپین مدار بدون اعمال کشش





شکل 5 : ساختار نواری GeCH₃ با وجود اثر اسپین مدار و اعمال 12٪ کشش

فاز توپولوژیک در GeCH₃

یکی از روش های تشخیص فاز توپولوژی وجود حالتهای لبه ای در نانو نوار سیستم است که برای نانو نوار زیگزاگ GeCH₃ با

پهنای حدود 8nm در شکل 6 و در حضور کشش رسم شده است و حالت های لبه ای در این سیستم کاملا مشخص است.



شکل 6 : ساختار نواری نانو نوار زیگزاگ و حالت های لبه ای (نوارهای قرمز)

نتيجه گيرى

یکی از عوامل موثر برای گذار فاز توپولوژی اعمال یک تنش مانند کشش در سیستم است که تقارن وارونی زمان را حفظ می کند و مدل تنگابست ما به خوبی می تواند ساختار نواری این ماده را در نزدیکی سطح فرمی و رفتار توپولوژیکی این ماده را تحت کشش توضیح دهد .

سپاسگزاری از همکاری آقای اسماعیل تقی زاده سی سخت وخانم زهرا اصلانی کمال تشکر و قدر دانی را داریم.

مرجعها

- M.Z.Hasan, C.L.Kane ; "Topological insulators ; Rev. Mod. Phys 82, 3045
- [2] Y.Ren, Z.Qiao "Topological phase in two-Dimensional Material : A Brief Review" arXiv preprint arXiv:1509.09016 (2015)
- [3] Y.Ma, Y.Dai, W.Wei, B.Huang and M.H.Whanhbo "Strain-induced quantum spin Hall effect in methyl-subtituted germanane Scientific reports 4 (2014): 7297
- [4] S.Jiang, et al. "Improving the stability and optical properties of germanane via one-step covalent methyl-termination." Nature communications 5, 3389 (2014).
- [5] J.Grosso "solid state physics"; 3th edition
- [6] M.Zhao, X.Chen, L.Li, X.Zhang "Driving a GaAs film to a large-gap topological insulator by tensile strian"; Scientific reports 5 (2015)
- [7] L.Li ,X.Zhang ,X.Chen ,M.zhao "Giant Topological Nontrivial Band Gap in Chloridized Gallium Bismuthide"; Nano Letters 15.2 (2015): 1296-1301